

02; 04; 07

ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНОЙ СРЕДЫ ИК ХИМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА ПРИ ГОРЕНИИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛА В ОКИСЛИТЕЛЕ

Б. Д. Бармашенко, В. А. Кочелап, Е. А. Шварчук, М. Т. Шпак

Показано, что образование активной среды ИК химических лазеров, возбуждаемых при электрическом взрыве проводников (ЭВП) в атмосфере окислителя, происходит при быстром распылении в процессе ЭВП капель и струй жидкого металла и последующем их горении в окислителе. Этот вывод сделан на основе анализа особенностей экспериментов по лазерной генерации при ЭВП и результатов проведенных нами дополнительных опытов по исследованию среды, образующейся при ЭВП Li в газах Cl₂, N₂, Ar. Теоретически изучено образование инверсии и усиления ИК излучения при горении капель жидкого горючего в атмосфере окислителя.

Введение

Для большинства действующих химических лазеров (ХЛ) активной средой служат газообразные реагирующие смеси. Другим возможным типом активной среды ХЛ является гетерофазная реагирующая среда, в которой один из реагентов распылен в виде мелкодисперсных частиц в атмосфере другого реагента. Ранее дисперсные среды (ДС) предлагалось использовать в CS₂—O₂^[1] и HF^[2, 3] лазерах. Применение реакций окисления металлов в качестве процессов накачки в ДС, испаряемых внешним светом, рассматривалось в^[4]. В настоящей работе показано, что действие известного широкого класса ИК химических лазеров, возбуждаемых при электрическом взрыве проводников (ЭВП) в атмосфере окислителя^[5], также основано на реакциях накачки в ДС. Образование активной среды лазеров^[5] происходит при быстром распылении в процессе ЭВП капель и струй жидкого металла и последующем их горении в окислителе. Этот вывод сделан на основе анализа особенностей экспериментов^[5] и результатов проведенных нами дополнительных опытов по исследованию среды, образующейся при ЭВП Li в газах Cl₂, N₂, Ar. В работе также теоретически изучено образование инверсии и усиления ИК излучения в ДС при горении капель жидкого горючего в атмосфере окислителя. Результаты применены к ряду конкретных пар металлов и окислителей.

Дисперсные активные среды ХЛ представляют интерес по ряду причин. Применение ДС существенно расширит круг веществ, пригодных для использования в ХЛ. ДС допускают рекордно быстрое перемешивание реагентов даже при высоких давлениях газовой фазы, в результате возможно образование ДС с высокой плотностью запасенной химической энергии. Для ДС достижим высокий темп химической накачки (средний по пространству), что особенно важно для ХЛ видимого диапазона^[6]. В режиме генерации возможен принципиально новый характер горения газожидкостной мелкодисперсной среды^[7].

1. Механизм образования активной среды химических лазеров при ЭВП в атмосфере окислителя

Лазерная генерация (спектральный диапазон 5—25 мкм) при ЭВП в атмосфере газов окислителей была получена и исследована более чем для 30 пар

металлов (M) и окислителей (XY) [5]. Рабочие молекулы, окислы металлов (MX), образуются в быстрых газофазных реакциях



причем часть η энергии экзотермичности реакции Q расходуется на образование колебательно-возбужденных молекул MX^+ ($\eta=0.5-0.9$). Специальными опытами была доказана химическая природа накачки MX в лазерах [5]. Для этих лазеров характерны следующие интересные особенности. ЭВП, установленного на расстоянии порядка 1 см от оптической оси резонатора, приводит к генерации через очень короткое время t_s (для $M=\text{Li}, \text{Mg}, \text{Al}$ и т. д., $XY=\text{F}_2, \text{O}_2, \text{NF}_3$, $t_s=1-2 \text{ мкс}$), т. е. горючее M заполняет резонатор со скоростью $u_s > 10^6 \text{ см/с}$ (I).¹ Причем успевает произойти перемешивание реагентов M и XY до молекулярного уровня (длительность генерации $t_r=0.5-3 \text{ мкс}$), что свидетельствует о сильно неоднородной по пространству подаче металла M (II). Величины t_s и t_r практически не изменяются при вариации давления окислителя P_{XY} в широких пределах (20–200 Тор) (III). В то же время для других типов ХЛ [8], использующих смешивание реагентов в резонаторе, характерны значительно большие времена приготовления активной среды и их существенная зависимость от давления P (допустимы $P < 10 \text{ Тор}$). Указанная особенность лазеров [5] до сих пор не получила объяснения.

При давлениях, характерных для [5], может существовать лишь частичная инверсия колебательно-вращательных уровней MX , причем $t_r < \tau_{VT}$, где τ_{VT} — время VT -релаксации MX^+ (IV). В реакционных зонах температура $T \approx T_f = (1-\eta)Q/c_p$ (c_p — теплоемкость газа). Обычно $(1-\eta)Q \geq 20 \text{ ккал/моль}$, т. е. $T_f \geq 2-4 \text{ кК}$. Но для всех MX τ_{VT} (T_f) $\ll t_r$. Большие (средние по пространству) τ_{VT} возможны лишь, если MX^+ успевают покинуть горячие зоны. Для этого пространственные масштабы r областей с горючим должны быть малыми (V): $r \ll \sqrt{D \tau_{VT}} (T_s)$ (D — коэффициент диффузии). Для $D = 1-10 \text{ см}^2/\text{с}$ τ_{VT} (T_f) $\leq 10^{-7} \text{ с}$ получается $r < 3-10 \text{ мкм}$.

В условиях экспериментов [5] вкладываемая при ЭВП энергия достаточна лишь для частичного испарения металла. В начальный момент образуется парожидкостная смесь (коллоид) [9] с $T=T_0=2-4 \text{ кК}$ и давлением в десятки атмосфер. Максимальная скорость расширения облачков и струй пара на стадии, где давление пара металла сравнимо с давлением окислителя, ограничена величиной $u_n^m = \sqrt{2 \gamma_M k T_0 / (\gamma_M - 1)} m_M$ (γ_M — показатель адиабаты пара M , m_M — атомная масса M). Числовое значение u_n^m всегда меньше 10^6 см/с . Однако известно, что при ЭВП высокотемпературный коллоид разлетается с начальной скоростью $u_k > 10^6 \text{ см/с}$ (см. ссылки в [5]). Некоторая доля жидкого металла в виде капель приобретает скорость $u \approx u_k$ и, опережая основную массу расширяющегося металла, по инерции пролетает значительные расстояния, прежде чем затормозится в окислителе. Летящие капли в соответствии с большой T_0 являются сильно перегретыми и испаряются; образуются следы из паров металла. Большие скорости капель, образование следов, горение капель и металла в следах объясняют наблюдаемые особенности I—III и соответствуют условиям IV—V, необходимым для образования инверсии.

Нами были проведены дополнительные эксперименты с ЭВП из Li в газах $\text{Cl}_2, \text{N}_2, \text{Ar}$ в режимах, характерных для [5]. Введение в объем специальных вкладышей позволило установить, что при ЭВП действительно разбрызгиваются капли Li радиусом $R=1-10 \text{ мкм}$, они пролетают расстояние 1–2 см. Капли наблюдались лишь на поверхностях вкладышей, обращенных к проводнику, на боковых поверхностях они отсутствовали, т. е. их появление не связано с конденсацией металла после ЭВП. Плотность капель уменьшалась при удалении вкладыша от проводника.

Были исследованы потери света с различными длинами волн ($\lambda=0.63, 1.15, 3.69, 10.6 \text{ мкм}$) в средах, образующихся при ЭВП в $\text{Ar}, \text{N}_2, \text{Cl}_2$. Для этого лазерный луч диаметром 0.5 см пропускался через среду параллельно

¹ Цифрами I, II, . . . будем отмечать качественные положения, позволяющие установить механизм образования активной среды.

проводнику на расстоянии ~ 1 см. Световые потери не были зафиксированы на временах $3-5$ мкс после ЭВП, т. е. на временах, сравнимых с t_s+t_r из [5], потери света отсутствовали (VI). Для больших времен потери возникали в N_2 и Cl_2 с подобной для всех λ кинетикой (рис. 1), для Ar потери практически отсутствовали. Анализ показал, что потери для $t > 5$ мкс связаны с неоднородностью среды, вызванной очаговым характером сгорания Li в N_2 и Cl_2 . Такое горение приводит к большим градиентам температуры, давления, к движению газа и пр.

Для подтверждения последнего вывода оптические неоднородности, образующиеся при ЭВП, были исследованы теневым методом (метод ножа в фокусе) [10]. Приведены шлирен-фотографии невозмущенной среды (рис. 2, а) и фотографии, выполненные через различные времена после начала импульса тока (рис. 2, б, в). Возмущения плотности среды идентифицируются по профилям почернения фотослоя и по изгибу интерференционных полос. На рис. 2, б, в видна сильно неоднородная область, прилегающая к первоначальному положению проводника и отделенная резкой границей. В ней сосредоточена большая часть паров M , реагирующих с Cl_2 и расширяющихся со сверхзвуковыми скоростями $\sim u_m^*$. Для $t \leq 2$ мкс ($\approx t_s$) размер неоднородной области не превышает 3-5 мм (рис. 2, б), для $t > 5$ мкс ($\approx t_s+t_r$) эта область расширяется, достигая размера ~ 1 см (рис. 2, в). Значительные потери света, обнаруженные при зондировании среды лазером, обусловлены перекрытием зондирующего луча областю сильных неоднородностей.

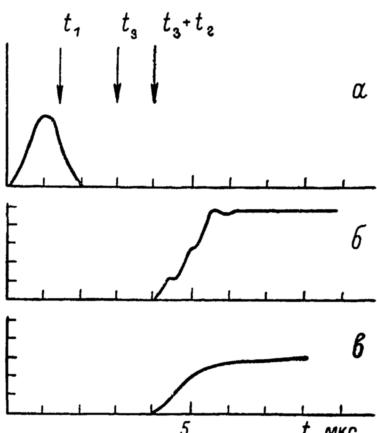


Рис. 1.

а — характерный импульс тока при ЭВП из Li в Cl_2 и N_2 , $U=20$ кВ, t_1 — начало разлета проводника; б — потери света с $\lambda=0.63$ мкм, $P_{Cl_2}=12$ тор; в — $P_{N_2}=20$ тор. Цена деления вдоль оси ординат 20 %.

а — характерный импульс тока при ЭВП из Li в Cl_2 и N_2 , $U=20$ кВ, t_1 — начало разлета проводника; б — потери света с $\lambda=0.63$ мкм, $P_{Cl_2}=12$ тор; в — $P_{N_2}=20$ тор. Цена деления вдоль оси ординат 20 %.

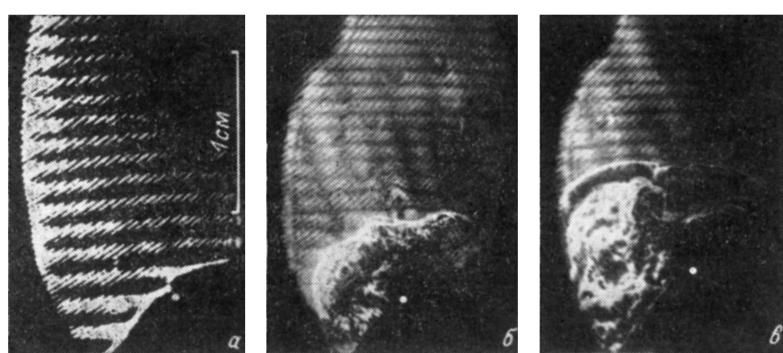


Рис. 2. Шлирен-фотографии ЭВП Li в Cl_2 , $P_{Cl_2}=76$ тор, $U=16$ кВ.

а — невозмущенная среда, б — через 2 мкс после начала импульса тока, в — через 4.6 мкс после начала импульса тока. Плоскость аккомодации теневого прибора удалена от ближнего конца проволоки на 7 см. Перемежающиеся интерференционные полосы равной толщины образованы интерференционным фильтром, помещенным между взрывной камерой и теневым прибором. Белая точка — первоначальное положение проводника.

Особенности расширения при ЭВП неоднородной области позволяют понять результаты экспериментов [5]. На временах $t \leq t_s$ оптически неоднородная область располагалась вне резонатора или захватывала лишь малую его часть. Она не оказывала влияния на генерацию. Для времен $t \geq t_s+t_r$ неоднородная среда частично заполняла резонатор, что приводило к срыву генерации. Этот вывод согласуется с установленным в [5] фактом слабой зависимости длительности генерации t_r от давления вплоть до $P_{xy} \simeq 1$ атм. Отсюда можно получить оценку для τ_{yt} снизу. Действительно, $\tau_{yt} > t_r$, так как в противном случае

сырья генерации был бы обусловлен процессами VT -релаксации MX^+ и t_r уменьшалось бы с ростом P_{XY} . Отсюда получаем $P_{XY} \tau_{VT} > 1$ мкс·атм.

Перед границей сильно неоднородной области на рис. 2 расположена слабовозмущенная зона протяженностью ~ 1 см. Сравнивая рис. 2, а и б, можно заметить в этой зоне слабые оптические неоднородности, вытянутые в виде темных «языков» (VII). Они отсутствовали при ЭВП Li, изолированного от объема, заполненного Cl_2 , кварцевой стенкой. Поэтому они не могут быть обусловлены воздействием излучения от взрыва на Cl_2 . Неоднородности отсутствуют и при ЭВП из Li в Ar. Можно заключить, что причиной возникновения оптических неоднородностей в слабовозмущенной зоне является химическая реакция окисления Li, проникшего в Cl_2 на глубину ~ 1 см. Как уже указывалось, столь глубокое проникновение возможно лишь при быстром распылении капель Li в Cl_2 .

Таким образом, перечисленные особенности (I—VII) лазеров, использующих ЭВП в окислителе, объясняются распылением с большими скоростями капель жидкого металла и последующим его окислением в газовой фазе. Образующаяся гетерофазная активная лазерная среда является оптически однородной и имеет поперечную протяженность более 1 см.

2. Модель образования инверсии и усиления ИК излучения при горении ДС

Исследуем простейшую модель гетерофазной активной лазерной среды, состоящей из неподвижных капель металла, горящих в атмосфере газообразного окислителя. Рассматривается случай самоподдерживающегося горения капель, что соответствует варианту чисто химического лазера. Модель позволяет проанализировать общие закономерности образования инверсии и усиления излучения в ДС, не зависящие от конкретного способа создания ДС.

Для случая создания ДС при ЭВП рассматриваемая модель описывает вклад в усиление от затормозившихся капель. Оценки вклада в усиление от следов за движущимися каплями приведены в разделе 4.

Горение в окислителе капель металлов Li, Mg, Al и др., обладающих низкой теплотой испарения, протекает следующим образом [11]. Каждая из капель окружена расположенной в газовой фазе зоной химической реакции. В эту зону изнутри поступают пары металла M , снаружи — окислитель XY . Испарение металла поддерживается подводом тепла из реакционной зоны к капле. В зоне химической реакции протекает процесс (I), приводящий к колебательному возбуждению молекул — продуктов реакции MX . Последующие процессы VV -обмена, VT -релаксации в газе и на поверхности металла и газотранспортные процессы могут привести к формированию вокруг каждой капли области с инверсной заселенностью колебательно-вращательных уровней MX . Для расчета инверсии и усиления излучения в среде предположим, что процессы VV -обмена навязывают неравновесное Больцмановское распределение молекул MX по колебательным уровням. В этом случае возможно образование частичной инверсии для P -ветви колебательно-вращательного спектра MX .

Коэффициент усиления (поглощения) излучения α в пространственно неоднородной среде, какой является ДС, можно выразить через локальное значение коэффициента усиления α_r и потери света на каплях γ_r [6]

$$\alpha = \alpha_r - \gamma_r, \quad \alpha_r = \sum_l [K_l] \int_{V_l} \alpha_l dV, \quad \gamma_r = \sum_l a_l [K_l]. \quad (2)$$

Здесь $[K_l]$ — концентрация капель радиуса R_l , суммы по l учитывают капли различных размеров. Коэффициенты a_l описывают потери излучения как на поглощение, так и на рассеяние, они зависят от длины волны λ , размеров и свойств капель и т. п.

Для колебательно-вращательного перехода $v, j-1 \rightarrow v-1, j$ (v, j —numеруют колебательные и вращательные состояния MX) локальное значение коэф-

фициента усиления α_v удобно выразить через неравновесный запас колебательных квантов, приходящихся на одну молекулу MX , ϵ_v

$$\alpha_v = \sigma_v^j \frac{(2j-1)\theta_r}{T} e^{-\frac{j(j+1)\theta_r}{T}} \frac{\epsilon_v(1-\beta)-\beta}{\epsilon_v(1+\epsilon_v)} \left(\frac{\epsilon_v}{1+\epsilon_v}\right)^v [MX]. \quad (3)$$

Здесь σ_v^j — сечение усиления в центре линии v , $j-1 \rightarrow v-1$, j ; θ_r — характеристическая вращательная температура MX ; T — локальная температура газа; $\beta = \exp(-2j\theta_r/T)$.

Пространственно-временные зависимости T , ϵ_v , $[MX]$, необходимые для вычисления α_v , можно найти, решая уравнения переноса [12] в окрестности каждой капли. Их удобно записать для величин

$$y_Z = \frac{[Z]}{\rho} (Z = M, XY, MX, \dots), \quad y_T = \frac{c_p T}{Q(1-\eta)}, \quad \epsilon_v = k\theta_v \epsilon_v [MX]/\rho,$$

где ρ — плотность, c_p и ϵ_v — теплоемкость и колебательная энергия единицы массы газа; θ_v — характеристическая колебательная температура MX .

Уравнения для y_Z и y_T имеют вид

$$\begin{aligned} \hat{L}y_M &= \hat{L}y_{XY} = -\hat{L}y_T = -W, \\ \hat{L} &\equiv \rho \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \rho D r^2 \frac{\partial}{\partial r}. \end{aligned} \quad (4)$$

Здесь $W = k[M][XY]$ — скорость реакции (I), r — расстояние от центра капли, \dot{m} — массовая скорость испарения капли. Принято, что коэффициенты диффузии всех компонентов одинаковы и равны D , число Льюиса равно 1. Зависимости $\epsilon_v(r, t)$ определяются уравнением, учитывающим VT -релаксацию

$$\hat{L}\epsilon_v = -\eta Q W - \frac{\rho \epsilon_v}{\tau_{vT}}, \quad \tau_{vT} = \left(\sum_Z k_{vT}^Z [Z] \right)^{-1}, \quad (5)$$

где k_{vT}^Z — константа скорости VT -релаксации на компоненте Z .

Границные условия к (4), (5) на поверхности капли

$$\left. \begin{aligned} j_M &= \frac{\dot{m}_l}{4\pi R_l^2 m_M}, \quad j_{XY} = j_{MX} = 0 \\ \rho D \left(\frac{\partial y_T}{\partial r} (1-\eta) Q + \frac{\partial \epsilon_v}{\partial r} \right) &= \frac{\dot{m}_l}{m_M} \frac{H}{4\pi R_l^2}, \quad \epsilon_v = 0 \end{aligned} \right\} r = R_l. \quad (6)$$

Здесь $j_Z = \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} y_Z - \rho D \frac{\partial y_Z}{\partial r}$ — плотность потока компоненты Z , m_Z — масса молекулы Z , H — теплота испарения атома металла M . Последнее равенство в (6) означает, что поверхность металла полностью дезактивирует MX^+ . Для $r \rightarrow \infty$ и при $t=0$ потребуем

$$y_M = y_{MX} = \epsilon_v = 0, \quad y_{XY} = y_{XY}^{(\infty)}, \quad y_T = y_T^{(\infty)}. \quad (7)$$

При записи (7) предполагается, что окислитель находится в избытке, нестационарная стадия разогрева капли не рассматривается.

В соответствии с результатами раздела 1 наиболее актуальны случаи

$$R_l \ll \sqrt{D\tau_{vT}(T_f)} \quad (8)$$

(масштабы областей, содержащих M , малы: $r \sim R$, MX^+ успевают покинуть эти горячие области с $T \sim T_f$). При условии (8) система (4)–(7) допускает аналитическое решение, которое находится в два этапа: решение «внутренней» задачи в областях, прилегающих к капле ($r \geq R_l$), из которого определяются потоки частиц MX и колебательной энергии в холодную зону, где возможно образование инверсии; решение «внешней» задачи ($r \gg R_l$) в холодной зоне.

Внутренняя задача. Будем рассматривать квазистационарное горение капель на временах $t \gg R_i^2/D$, тогда в (4), (5) можно опустить члены с $\partial/\partial t$. Согласно (8), не существенны также члены, содержащие τ_{VT} . Из решения внутренней задачи в пределе узкой (по сравнению с масштабом $r \sim R_i$) зоны реакции для \dot{m}_l и плотностей потоков MX и e_v во внешнюю область получается

$$\dot{m}_l = 4\pi\rho DR_l \ln \left[1 + \frac{Qy_{XY}^{(\infty)} - c_p(T_0 - T_\infty)}{H} m_M \right], \quad (9)$$

$$j_{MX}^{(i)} = \frac{1}{\eta Q} j_{e_v}^{(i)} = \frac{\dot{m}}{4\pi r^2 m_M}, \quad (10)$$

$$x = \frac{(Q - H) y_{XY}^{(\infty)} - C_p(T_0 - T_\infty)}{Qy_{XY}^{(\infty)} - c_p(T_0 - T_\infty)}. \quad (11)$$

Здесь T_0 — температура капли, приближенно равная температуре кипения металла M при давлении P_{XY} . Из (10) видно, что во внешнюю область поступает доля x колебательной энергии ηQ , выделяемой в реакции. Остальная энергия теряется при дезактивации MX^+ на поверхности капель.

Внешняя задача. В области $r \gg R_i$ следует решать нестационарные уравнения (4), (5) с учетом VT -релаксации. В этой области можно считать D_r , ρ , $\tau_{VT} \approx \text{const}$, $T \approx T_\infty$ (критерий последнего см. ниже) и пренебречь процессом конвекции. Для u_{MX} и e_v граничными условиями для внешней задачи служат равенства (10), для других переменных начальные и граничные условия даются в (7). Приведем решения для u_{MX} и e_v

$$u_{MX} = \frac{\dot{m}}{4\pi\rho D m_M \sqrt{D\tau_{VT}(T_\infty)} \xi} \left(1 - \Phi \left(\frac{\xi}{2\sqrt{\tau}} \right) \right), \quad e_v = x\eta Q y_{MX} \varepsilon(\xi, \tau),$$

$$\varepsilon(\xi, \tau) = \frac{e^{-\xi} \left[1 - \Phi \left(\frac{\xi}{2\sqrt{\tau}} - \sqrt{\tau} \right) \right] + e^{\xi} \left[1 - \Phi \left(\frac{\xi}{2\sqrt{\tau}} + \sqrt{\tau} \right) \right]}{2[1 - \Phi(\xi/2\sqrt{\tau})]}. \quad (12)$$

Здесь $\xi = r/\sqrt{D\tau_{VT}(T_\infty)}$, $\tau = t/\tau_{VT}(T_\infty)$, $\Phi(x) = 2/\sqrt{\pi} \int_0^x e^{-t^2} dt$.

Формулы (3), (12) при выполнении (8) позволяют рассчитать $\bar{\alpha}_r$, так как основной вклад в интеграл из (2) вносит внешняя область. Упростим (3), воспользовавшись неравенствами $\varepsilon_v \gg 1$ и $j\theta_r/T_\infty \ll 1$, характерными для рассмотренных ниже конкретных реакций

$$\bar{\alpha}_r \approx \sigma_v^j e^{-j^2\theta_r/T} \frac{2j\theta_r}{T} \frac{\varepsilon_v \frac{2j\theta_r}{T} - 1}{\varepsilon_v^2} e^{-v/\varepsilon_v} [MX]. \quad (3')$$

В результате из (3'), (2) и (12) для пространственно усредненного коэффициента усиления $\bar{\alpha}_r$ получаем

$$\bar{\alpha}_r = \frac{2\sigma_0 j\theta_r \tau_{VT}(T_\infty) k\theta_v}{x\eta Q T_\infty} \left(\sum_l \frac{\dot{m}_l}{m_M} [K_l] \right) e^{-j^2\theta_r/T_\infty} \mathcal{J}(\tau, w, \mathcal{K}),$$

$$\mathcal{J}(\tau, w, \mathcal{K}) \equiv w \int_0^\infty d\xi \frac{\mathcal{K}\varepsilon - 1}{\varepsilon^2} e^{-w/\varepsilon} \left[1 - \Phi \left(\frac{\xi}{2\sqrt{\tau}} \right) \right]. \quad (13)$$

Здесь положено $w \equiv v k\theta_v / x\eta Q$, $\mathcal{K} \equiv \frac{2x\eta Q\theta_r j}{k\theta_v T_\infty}$, $\sigma_v^j = \sigma_0^j$.

Проанализируем полученные результаты. Поскольку в (12), (13) входит величина $\varepsilon(\xi, \tau) \ll 1$, то существует необходимое условие возникновения ин-

версии ($\bar{\alpha}_r > 0$): $\mathcal{K}(j) > 1$. Отсюда следует, что инверсия реализуется для вращательных уровней

$$j > j^* \equiv \frac{k\theta_v T_\infty}{2\pi\eta Q\theta_r}. \quad (14)$$

Это условие только множителем x^{-1} отличается от условия образования частичной инверсии в случае гомогенной реакции. Отметим, что (14) не зависит от радиуса капель R_i . Эта величина входит лишь в \dot{m}_i (см. (9)). Ниже везде будем считать капли одинаковыми $R_i \equiv R$, $\dot{m}_i \equiv \dot{m}$, $[K_i] \equiv [K]$.

Наиболее существенная временная зависимость $\bar{\alpha}_r$ определяется функцией $\mathcal{J}(\tau)$ из (13), представленной на рис. 3 для фиксированного \mathcal{K} и различных w . Видно, что $\mathcal{J}(\tau)$ имеет максимум при некотором $\tau = \tau_m$, зависящий от w и \mathcal{K} . Можно поставить вопрос об определении верхней границы $\bar{\alpha}_r$ как функции τ ,

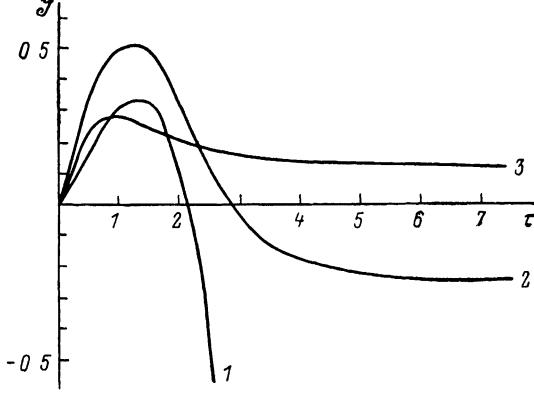


Рис. 3. Зависимости $\mathcal{J}(\tau)$ для $\mathcal{K}=3$.

w : 1 — 0.2, 2 — 0.6, 3 — 1.6.

w и \mathcal{K} . Оказывается, что Supr $\bar{\alpha}_r$ зависит лишь от одного параметра $E \equiv (k\theta_v)^2 T_\infty / 4Q^2 \eta^2 x^2 \theta_r$

$$\text{Supr } \bar{\alpha}_r = \sigma_0 \frac{\dot{m} \tau_v T}{m_M} \left(\frac{k\theta_v}{Q\eta_v x} \right)^2 F_m(E)[K] \equiv \Sigma[K], \quad (15)$$

функция $F_m(E)$ приведена на рис. 4, а. Там же приведены значения τ_m , w_m , \mathcal{K}_m , при которых достигается (15). Поясним, как пользоваться рис. 4, а. Для выбранной реакции накачки (I) вычисляется величина E , по этой величине и рис. 4, а находятся w_m и \mathcal{K}_m и определяются уровни v_m , j_m , для которых достигается максимальное усиление, а также соответствующий момент времени τ_m , величина $F_m(E)$ и, наконец, Supr $\bar{\alpha}_r$.

Из рис. 3 видно, что для невысоких w (низкие колебательные уровни v) инверсия существует лишь на временах $t \leq \tau_{vt}$. Однако для $w > w^*(\mathcal{K})$ (высокие v) инверсия сохраняется при $t \geq \tau_{vt}$. $w^*(\mathcal{K})$ определяется условием $\mathcal{J}(\infty, w^*, \mathcal{K}) = 0$. Зависимость $w^*(\mathcal{K})$ приведена на рис. 5. В предельных случаях для $w^*(\mathcal{K})$ получается $\mathcal{K} \gg 1$, $w^* \approx 1/\mathcal{K}$, $\mathcal{K} - 1 \ll 1$, $w^* \approx 2/(\mathcal{K} - 1)$. Можно рассчитать верхний достижимый предел $\bar{\alpha}_r$, реализующийся на больших временах ($t \geq \tau_{vt}$). Для этого достаточно в (15) вместо $F_m(E)$ использовать зависимость $F_\infty(E)$, представленную на рис. 4, б. Там же приведены значения $w_m^{(\infty)}$ и $\mathcal{K}_m^{(\infty)}$, при которых $\bar{\alpha}_r$ максимально. Видно, что для фиксированных E значение F_∞ ниже, а $w_m^{(\infty)}$, $\mathcal{K}_m^{(\infty)}$ выше, чем соответствующие характеристики для времен $t < \tau_{vt}$. Возможность поддержания частичной инверсии MX^+ на временах $t \geq \tau_{vt}$ является важной специфической особенностью реагирующих ДС (в ХЛ с гомогенной накачкой время существования инверсии меньше или порядка τ_{vt}). Для ДС время существования инверсии сверху ограничено временем сгорания капель.

При наличии инверсии для усиления излучения требуется удовлетворить условию $\alpha_r > \gamma_k$ (см. (2)). Для оценок положим $a_r = a = \pi R^2 f$, тогда указанное условие можно представить в виде ограничения на R и давление окислителя P_{XY}

$$RP_{XY}^2 < (RP_{XY}^2)_c \equiv \frac{4\sigma^* \tau_{VT}^* D (k\theta_V)^2}{m_M \chi^2 \eta^2 Q^2 f} F_m(E) \ln \left[1 + \frac{Qy_{XY}^{(\infty)} - c_p (T_0 - T_\infty)}{H} m_M \right], \quad (16)$$

где σ^* и τ_{VT}^* — значения σ_0 и τ_{VT} при $P_{XY} = 1$ атм. Аналогичный критерий существует для сохранения усиления на длительных временах $t > \tau_{VT}$: $RP_{XY}^2 < (RP_{XY}^2)_c \equiv (RP_{XY}^2)_c \frac{F_\infty(E)}{F_m(E)}$.

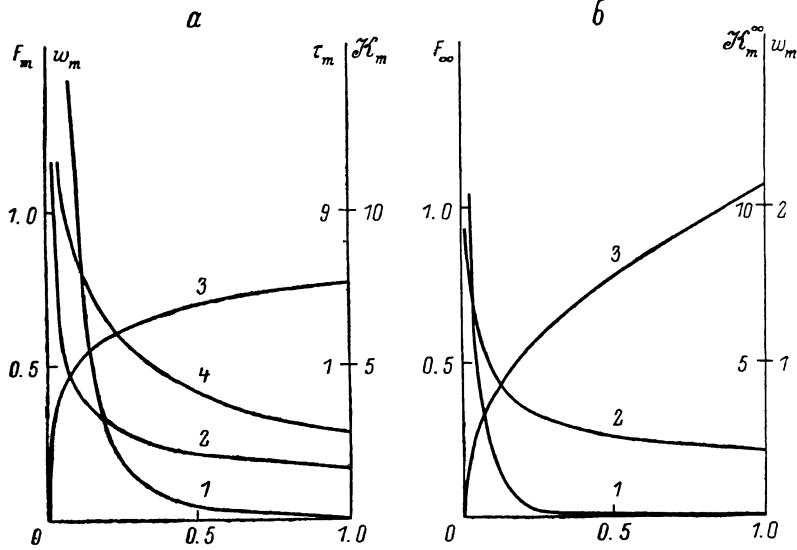


Рис. 4.

а: 1 — F_m , 2 — \mathcal{K}_m , 3 — w_m , 4 — τ_m ; б: 1 — F_∞ , 2 — \mathcal{K}_m^∞ , 3 — w_m^∞ .

Для ДС, удовлетворяющей условиям (16), критерием возбуждения генерации будет

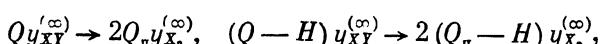
$$\alpha_r - \gamma_k = (\Sigma - f\pi R^2)[K] > g_c = \frac{1-\chi}{l}. \quad (17)$$

Здесь g_c — пороговый коэффициент усиления, определяемый через коэффициент отражения зеркал χ и протяженность ДС l .

Выражение (17) накладывает ограничение снизу на концентрацию капель $[K]$. Отметим, что, несмотря на существенную неоднородность ДС, молевая структура резонатора сохраняется, если длина рассеяния света на каплях $l_p \gg l$ ($l_p \geq 1/\pi R^2 [K]$).

Условия (16), (17) определяют необходимые для возбуждения генерации значения параметров ДС R , $[K]$, P_{XY} .

Выше предполагалось, что продукт Y реакции (I) не реагирует с M . Однако для реакции накачки вида $M + X_2 \rightarrow MX + X$ следует учитывать рекомбинацию M и X . Такая рекомбинация наиболее эффективно протекает на поверхности капли. Для ее учета достаточно сделать замену в формулах (9), (11), (16)



где Q_n — энергия экзотермичности реакции $M + 1/2X_2 \rightarrow MX$.

3. Расчеты для конкретных ДС

Применим полученные результаты к расчету усиления для ряда конкретных реакций в ДС. Рассматривались неразбавленные смеси $M-X_2$ ($y_{X_2}^{(\infty)}=1/m_X$), приведенные в таблице. Отметим, что для пар $M-X_2$ (1, 3, 4) наблюдалась лазерная генерация при ЭВП.

№ пары	$M - X_2$	$(RP_{XY}^2)_c \cdot 10^5$, см · атм ²	λ_m , мкм	$(RP_{XY}^2)_c^{(\infty)} \cdot 10^5$, см · атм ²	$\lambda_m^{(\infty)}$, мкм
1	$\text{Li} - \text{F}_2$	10	14	4	16
2	$\text{Li} - \text{Cl}_2$	1.5	19	0.15	23
3	$\text{Al} - \text{F}_2$	0.4	15	0.07	18
4	$\text{Mg} - \text{F}_2$	0.4	17	0.05	22

Приведем более подробно результаты расчетов для пары $\text{Li}-\text{F}_2$. Для молекулы LiF $\theta_r=1.9$ К, $\theta_v=1.3$ кК, энергия экзотермичности (1) $Q=101$ ккал/моль, теплота испарения $\text{Li} H=35$ ккал/моль. Было принято также, что доля энергии Q , идущая в колебания, $\eta=0.75$, исходная температура $T_\infty=300$ К. Для температуры капли получается $T_0=1.3$ кК ($P_{\text{F}_2} \sim 0.1$ атм). Тогда из (11) следует, что в зону инверсии поступает доля колебательной энергии, выделяемой в (1), $x=0.7$. Согласно (14), инверсия реализуется для вращательных уровней $j > j^*=4$. Необходимое для расчета усиления значение параметра $E=0.9$ (см. (15)). Из рис. 4, а находим, что максимум усиления достигается через время $\tau_m=1.7$ для уровней $v_m=10$, $j_m=16$, соответствующая длина волны излучения λ_m приведена в таблице. Величина $F_m(E)=0.2$. При расчете сечения усиления использовалось значение вероятности радиационного перехода $A=70$ с⁻¹ [13] и учитывалось ударное уширение. Тогда $\sigma^*=4.5 \cdot 10^{-16}$ см² · атм. Для оценки скорости VT -релаксации LiF^+ принималось $\tau_{VT}=1$ мкс · атм (см. раздел 1). С использованием этих величин рассчитывалось входящее в условие усиления (16) $(RP_{\text{F}_2}^2)_c$ (см. таблицу).

Для колебательных уровней $v > v^*$

(\mathcal{H}) возможно существование инверсии на длительных временах $t \gg \tau_{VT}$, например, для $j=j_m=16$ $v^*=10$ (рис. 5). Максимальное усиление при этом реализуется для уровней $v_m^{(\infty)}=15$, $j_m^{(\infty)}=18$, определяемых из рис. 4, б. Соответствующая длина волны $\lambda_m^{(\infty)}$ приведена в таблице, там же представлено значение $(RP_{\text{F}_2}^2)_c^{(\infty)}$. Аналогичные расчеты были проведены и для остальных пар $M-X_2$, представленных в таблице.

Пользуясь полученными результатами для каждой пары $M-X_2$, можно определить параметры ДС, необходимые для получения усиления. Так, в ДС $\text{Li}-\text{F}_2$ критерий (16) выполняется для достаточно крупных капель с $R=10$ мкм при значительных давлениях $P_{\text{F}_2} < 0.3$ атм. При $P_{\text{F}_2}=0.1$ атм $\Sigma \equiv \text{Supr } \bar{\alpha}_r/[K] = 3 \cdot 10^{-5}$ см² (см. (15)), и для достижения усиления 10^{-3} см⁻¹ концентрация [K] должна превышать 50 см⁻³, что соответствует осредненной по объему концентрации металла 10^{16} см⁻³. При таких параметрах ДС усиление сохраняется и на длительных временах $t \gg \tau_{VT}$.

4. Оценки усиления излучения в паровых следах за каплями

При рассмотрении ДС, создаваемой при ЭВП, необходимо учитывать движение капель, их дробление, испарение за счет аэродинамического нагрева,

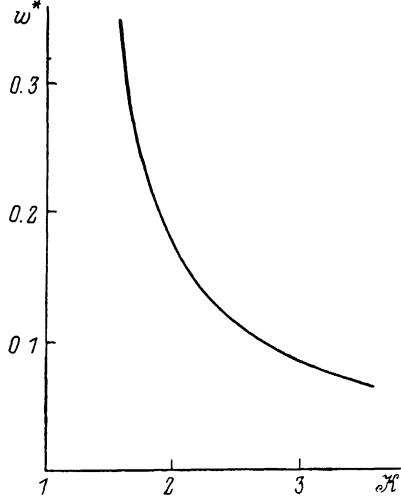


Рис. 5.

образование инверсии в следах. Приведем оценки этих эффектов. Крупные капли M , влетающие в окислитель, быстро дробятся. Дробление происходит, если $\rho u_{\kappa}^2 R / \sigma_M > 10$ [14] (σ_M — коэффициент поверхностного натяжения M). Для $[X_2] = 10^{18} \text{ см}^{-3}$, $u_{\kappa} = 10^6 \text{ см/с}$, $\sigma_{\text{Li}} = 400 \text{ дн/см}^2$ получается $R > 0.5 \text{ мкм}$. Мелкие капли ($R \leq 1 \text{ мкм}$) тормозятся в окислителе за времена $t_D \approx R/u_{\kappa} \times \sqrt{[M_{\kappa}] m_{X_2} / [X_2] m_X}$ [15], пролетая расстояние $l_D \approx u_{\kappa} t_D$. При $R \leq 1 \text{ мкм}$ получается $t_D \leq 1 \text{ мкс}$ и $l_D \leq 1 \text{ см}$. Следовательно, за времена $t < t_D$ мелкие капли M успевают затормозиться в резонаторе и вносят вклад в усиление, описываемое приведенной выше моделью.

Движущиеся капли испаряются, за ними образуются горящие паровые следы. Размеры горячей зоны в следе малы ($R \times R \times u_{\kappa} \frac{R^2}{D}$), температура большей части следа близка к начальной T_{∞} . Эта часть следа содержит MX^+ и обеспечивает усиление на временному интервале τ_{vt} (T_{∞}). Вклад в α от следов ($\bar{\alpha}_r$)_c для времен $t < \tau_{\text{vt}}$ (T_{∞}) равен

$$(\bar{\alpha}_r)_c = \sigma_0 \sqrt{\frac{2\theta_r}{T_{\infty}}} e^{-s_{l_2}} \frac{k\theta_v \left(\frac{Q\eta}{k\theta_v} \sqrt{\frac{2\theta_r}{T_{\infty}}} - 1 \right)}{Q\eta} \langle [M] \rangle_v,$$

где $\langle [M] \rangle = [M_{\kappa}] [K] 4 / 3\pi R^3$ — осредненная по объему концентрация M , v — доля испаренного металла.

При учете лишь аэродинамического нагрева получаем, что для затормозившихся капель $v = 1 - \exp(-u_{\kappa}^2 / 2c_p H)$, где $c_p \approx 3$ [15]. Для пары Li—F₂ при $u_{\kappa} = 10^6 \text{ см/с}$, $P_{F_2} = 0.1 \text{ атм}$ получаем $v = 0.2$, $(\bar{\alpha}_r)_c = 2 \cdot 10^{-18} \text{ см}^2 \langle [M] \rangle$. Для сравнения приведем значение $\bar{\alpha}_r$ из (13) для неподвижных капель. При $P_{F_2} = 0.1 \text{ атм}$, $R = 1 \text{ мкм}$, $t = 2 \text{ мкс} \sim t_D$, $\bar{\alpha}_r = 2 \cdot 10^{-18} \text{ см}^2 \langle [M] \rangle$. Видно, что $(\bar{\alpha}_r)_c \approx \bar{\alpha}_r$, т. е. вклад в усиление от следов порядка вклада от затормозившихся капель. Для достижения $\alpha = 10^{-3} \text{ см}^{-1}$ необходимо $\langle [M] \rangle \geq 5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$.

Заключение

Результаты описанных экспериментов и проведенного теоретического исследования свидетельствуют о реальности нового типа активной среды ХЛ — горящей газожидкостной мелкодисперсной среды. В такой среде возможно достижение высоких плотностей реагентов, а следовательно, и значительной запасенной химической энергии. Процессам образования инверсии и усиления в ДС присущи интересные особенности, например возможность длительного существования инверсии на временах, превышающих τ_{vt} , и др. Лазеры с дисперсной активной средой на основе реакций окисления металлов являются возможным вариантом актуальных лазерных систем, излучающих в области $\lambda > 15 \text{ мкм}$.

В работе проанализирован конкретный случай образования гетерофазной лазерной среды при ЭВП в окислителе. Этот случай не является оптимальным, так как сопровождается быстрым разрушением активной среды. Другими возможными методами создания реагирующей ДС $M-XY$ могут быть инициирование внешним светом горения предварительно приготовленной ДС, инъекция горячих капель M в поток окислителя и др.

Литература

- [1] Алферов В. И., Бирюков А. С., Дмитриев Л. М. и др. // ДАН СССР. 1979. Т. 248. № 3. С. 1093—1096.
- [2] Chiu H. Y., Somers R. M., Benson R. C. // Chem. Phys. Lett. 1979. Vol. 1. N 1. P. 203—208.
- [3] Игошин В. И., Пичугин С. Ю. // Квант. электр. 1983. Т. 10. № 9. С. 1922—1924.
- [4] Александров В. Я., Андреев А. П., Виноградов В. Ю., Подлощенский И. В. // Опт. и спектр. 1980. Т. 48. Вып. 3. С. 469—473.
- [5] Джесен Р. // Химические лазеры / Под ред. Р. Гросса, Дж. Ботта. М.: Мир, 1980. 831 с.
- [6] Кочелап В. А., Пекар С. И. Теория спонтанной и стимулированной хемилюминесценции газов. Киев: Наукова думка, 1986. 264 с.

- [7] Бармашенко Б. Д. // Квантовая электроника. Киев: Наукова думка, 1985. № 28-С. 14—24.
- [8] Химические лазеры / Под ред. Н. Г. Басова. М.: Наука, 1982. 400 с.
- [9] Взрывающиеся проволочки / Под ред. А. А. Рухадзе. М.: Изд-во ИЛ, 1963. 341 с.
- [10] Васильев Л. А. Теневые методы. М.: Наука, 1968. 400 с.
- [11] Погодин П. Ф., Беляев А. Ф., Фролов Ю. В. и др. Горение порошкообразных металлов в активных средах. М.: Наука, 1972. 430 с.
- [12] Вильямс Ф. А. Теория горения. М.: Наука, 1971. 616 с.
- [13] Хьюбер К. П., Герцберг Г. Константы двухатомных молекул. М.: Мир, 1984. Т. 1. 408 с.
- [14] Раушенбах Б. В. Физические основы рабочего процесса в камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей. М.: Машиностроение, 1964. 236 с.
- [15] Алферов В. И., Бирюков А. С., Божкова Е. А. и др. // Квант. электр. 1979. Т. 6. № 8. С. 1746—1754.

Институт полупроводников

АН УССР

Киев

Поступило в Редакцию

5 февраля 1987 г.

В окончательной редакции

6 июня 1988 г.